



トピックス

**2015イノベーション四国顕彰事業 表彰式**  
～株式会社キシモト様が革新技术賞を受賞～

平成28年2月29日(月)、高松シンボルタワーかがわ国際会議場において、「2015イノベーション四国顕彰事業表彰式(主催：四国地域イノベーション創出協議会)」が開催され、「四国産業技術大賞」及び「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の二つの表彰式が行われました。弊所は同協議会の副事務局を務めており、四国産業技術大賞：革新技术賞として株式会社キシモト様に対し、弊所所長名にて表彰状を授与しました。受賞者及び賞の概要は以下の通りです。

**【四国産業技術大賞】**

四国地域の産業技術の発展に顕著な貢献のあった企業等を表彰するもので、今回で20回目の表彰となります。山本貴金属地金株式会社(高知県香南市)様をはじめ7社が各賞を受賞されました。

◇**産業振興貢献賞**(技術開発成果が優秀で、産業振興や地域活性化に顕著な貢献があったもの)

山本貴金属地金株式会社(高知県香南市)

「『フッ素徐方性』と『高強度・耐久性』を両立した最先端歯科材料『KZR-CAD HRブロック2』」

◇**革新技术賞**(技術開発成果が特に優秀であったもの)○**最優秀賞**

株式会社キシモト(愛媛県東温市)

「骨まで食べられる干物『まるっと』の開発」

◇**技術功績賞**(技術開発成果が地域産業および当該企業の発展に特に顕著な貢献があったもの)○**最優秀賞**

石原金属株式会社(徳島県徳島市)

株式会社 阿波銀行(徳島県徳島市)

株式会社 テクノネットワーク四国(香川県高松市)

「ステンレス鋼板の400番研磨を可能とする大型湿式研磨加工装置の開発」

○**奨励賞**

・株式会社 土佐ひかり CDM(高知県高知市)

「高知県産魚種やニラそぐり未利用残渣を活用した養鶏・養殖魚用試料や肥料の商品化」

・菅機械産業株式会社(愛媛県松山市)

「汎用タイプの高精度位置決め装置の開発」

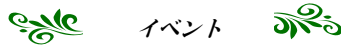
【参加お申込み、プログラム等の詳細はこちらから】

イノベーション四国 表彰式

検索

CLICK!!

<http://www.tri-step.or.jp/s-innovation/>



イベント

## 第92回「高松5：30クラブ」

### 【開催趣旨】

地域を元気にする意欲に燃えた人が集まり、肩書き抜きで交流する場、普段なかなか知り合えないような人が一同に集まり、ネットワークの輪を広げる場として「高松5：30クラブ」を開催しています。

【日 時】 平成28年5月13日(金) 第1部（講演会）16:00～ 第2部（交流会）17:30～

【会 場】 高松サンポート合同庁舎（〒760-0019 香川県高松市サンポート3-33）  
第1部（講演会）：アイホール（合同庁舎低層棟2階）  
第2部（交流会）：レストランコルネット（合同庁舎1階）

【参加費】 1,000円

### 【事務局：7機関】

四国経済連合会、高松商工会議所、香川大学、香川経済同友会、産総研四国センター、  
四国経済産業局、四国産業・技術振興センター

【問い合わせ先】 〒760-0033 香川県高松市丸の内2-5  
一般財団法人 四国産業・技術振興センター  
E-mail：step@tri-step.or.jp  
TEL：087-851-7025 FAX：087-851-7027

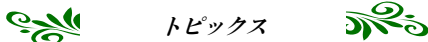
【参加お申込み、プログラム等の詳細はこちらから】

高松5：30クラブ

検索

CLICK!!

<http://www.tri-step.or.jp/event/530club.html>



トピックス

## 産総研の最近の主な研究成果

（平成28年3月のプレス発表より）

<発表・掲載日：2016/03/03>

### 世界最高水準の標準ガスバリアフィルムを開発

—有機ELの長寿命化への貢献に期待—

#### 【ポイント】

- ・水蒸気に対して優れたバリア性能をもつ標準ガスバリアフィルムを開発
- ・粘土にポリイミドを添加して作製した高機能粘土膜クレスト®を利用
- ・有機ELで用いられるハイバリアフィルムの品質向上への貢献に期待

#### 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016/pr20160303/pr20160303.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016/pr20160303/pr20160303.html)

（工学計測標準研究部門、化学プロセス研究部門）



<次ページへ>

&lt;前ページから&gt;

&lt;発表・掲載日：2016/03/08&gt;

**光照射で効率的に発熱するナノコイル状の新素材を開発**

—近赤外レーザーによるがん光熱療法への応用に期待—

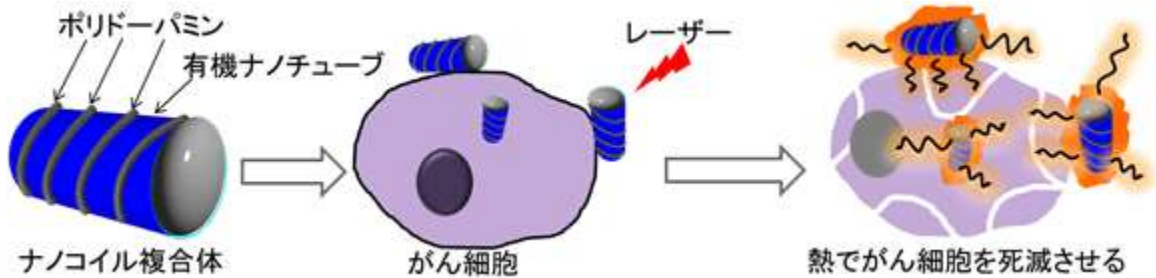
## 【ポイント】

- ・生体透過性の近赤外レーザーで効率的に発熱するナノコイル状の新素材を簡便に合成
- ・培養したがん細胞へ添加し、レーザー照射すると、6割以上の細胞が死滅
- ・近赤外レーザーを用いた生体深部のがん治療への応用に期待

## 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/new\\_research/2016/nr20160308/nr20160308.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2016/nr20160308/nr20160308.html)

(機能化学研究部門、ナノ材料研究部門)



&lt;発表・掲載日：2016/03/16&gt;

**アルツハイマー病の原因とされるタンパク質を細胞内で可視化する技術を開発**

—発症メカニズムの解明や治療薬の候補物質のスクリーニングに貢献—

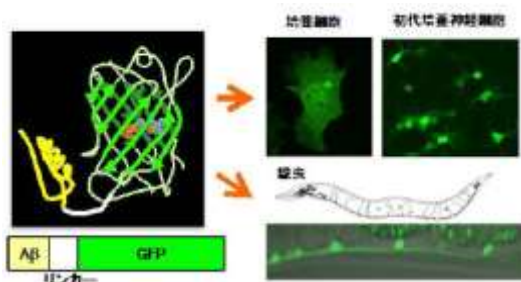
## 【ポイント】

- ・アルツハイマー病の原因因子の一つであるアミロイドβタンパク質 (Aβ) の動態を生体内で可視化
- ・Aβと蛍光タンパク質GFPの融合を工夫し、Aβが凝集しても蛍光が観察されるタンパク質を開発
- ・GFPの蛍光強度を利用した簡便・迅速な治療薬の探索と、詳細な発症メカニズムの理解へ貢献

## 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016/pr20160316\\_2/pr20160316\\_2.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016/pr20160316_2/pr20160316_2.html)

(バイオメディカル研究部門)



&lt;次ページへ&gt;

&lt;前ページから&gt;

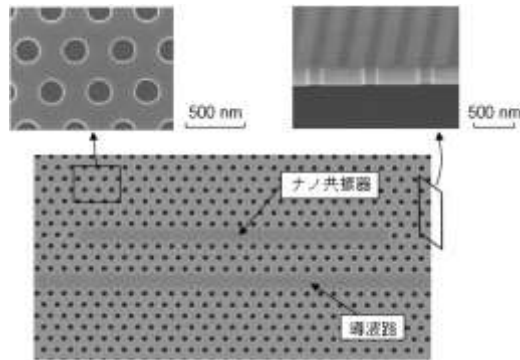
&lt;発表・掲載日：2016/03/16&gt;

**世界最高レベルのQ値を有する光ナノ共振器の大量作製に成功****【ポイント】**

- ・工業生産に適したフォトリソグラフィ法を使用し、従来の100万倍のスピードで作製
- ・世界最高レベルのQ値150万を達成、超高Q値光ナノ共振器の普及へ
- ・シリコンレーザーや光メモリー、簡便に使える医療診断センサーの開発等応用に期待

**【詳細はこちら】**[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016/pr20160316/pr20160316.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016/pr20160316/pr20160316.html)

(電子光技術研究部門)



&lt;発表・掲載日：2016/03/18&gt;

**レアアースを添加せずに窒化物で世界最高水準の圧電性能を実現**

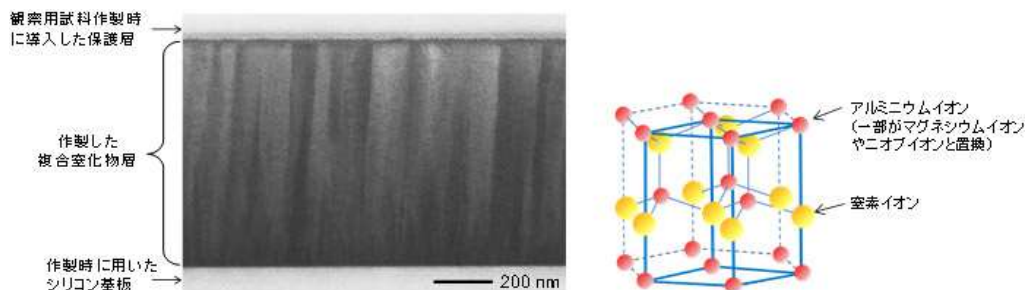
— スカンジウム添加窒化アルミニウムと同等レベルの性能の圧電材料 —

**【ポイント】**

- ・窒化アルミニウムにマグネシウムとニオブを添加して世界最高水準の性能を持つ圧電材料を開発
- ・レアアースのスカンジウムを使わずに安価なマグネシウムとニオブで圧電性能を向上
- ・次世代通信機器用の高周波フィルターやセンサーネットワークへの利用に期待

**【詳細はこちら】**[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016/pr20160318/pr20160318.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016/pr20160318/pr20160318.html)

(製造技術研究部門)



&lt;次ページへ&gt;



&lt;前ページから&gt;

&lt;発表・掲載日：2016/03/22&gt;

**水素ステーション用蓄圧器の損傷評価技術を開発**

—蓄圧器内側の疲労き裂を外観検査により可視化—

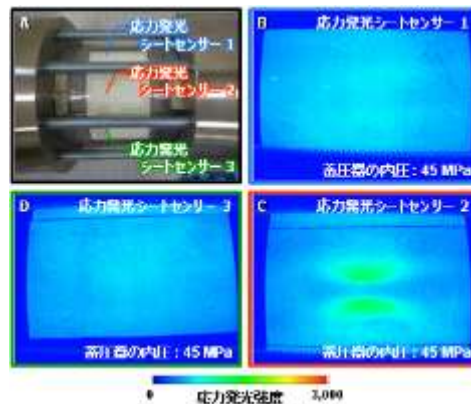
## 【ポイント】

- ・蓄圧器外表面に応力発光シートセンサーを接着して蓄圧器内部の損傷を可視化
- ・応力発光パターン解析により内部き裂の進展度を算出
- ・水素ステーションや高圧設備の安全性への貢献に期待

## 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/new\\_research/2016/nr20160322/nr20160322.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2016/nr20160322/nr20160322.html)

(製造技術研究部門)



&lt;発表・掲載日：2016/03/23&gt;

**ニッケル化合物を用いた簡便なシアノ化反応の開発**

—猛毒のシアン化物を用いないニトリル化合物の製造法—

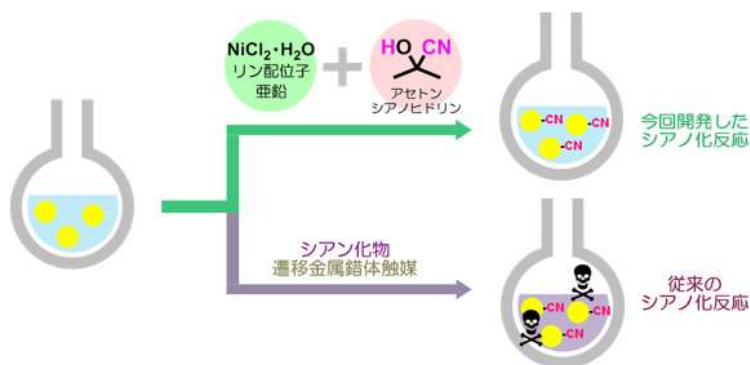
## 【ポイント】

- ・安価で入手容易なニッケル化合物を原料に高活性な触媒を開発
- ・猛毒のシアン化物を毒性の低いアセトンシアノヒドリンで代替
- ・ニトリル基をもつ有用化学品開発への貢献に期待

## 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016//pr20160323\\_2/pr20160323\\_2.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016//pr20160323_2/pr20160323_2.html)

(触媒化学融合研究センター)



&lt;次ページへ&gt;

&lt;前ページから&gt;

&lt;発表・掲載日：2016/03/23&gt;

**低濃度の金属廃液から金とパラジウムを効率的に回収**

—硫酸性温泉に生息する紅藻の優れた能力活用の可能性—

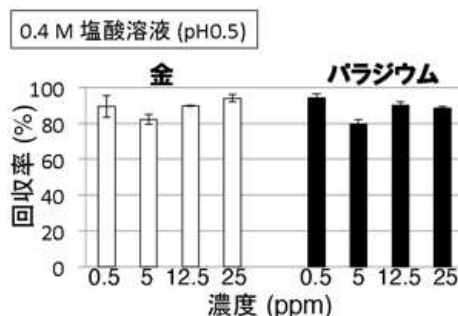
## 【ポイント】

- 高温・酸性条件の硫酸性温泉に生息する紅藻が、強酸性条件下でも低濃度の金とパラジウムを高い効率で回収することを発見
- 金やパラジウムの10倍近い濃度の銅を含む実際の金属廃液からでも、金とパラジウムを選択的に短時間で吸着回収、溶出できることも確認
- 環境に優しい効率的な回収方法の実用化に有望

## 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016/pr20160323/pr20160323.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016/pr20160323/pr20160323.html)

(物質計測標準研究部門)



&lt;発表・掲載日：2016/03/28&gt;

**ヒトの神経細胞の発生を調節するタンパク質の機能を発見**

—ヒトに特徴的な機構の存在を示唆—

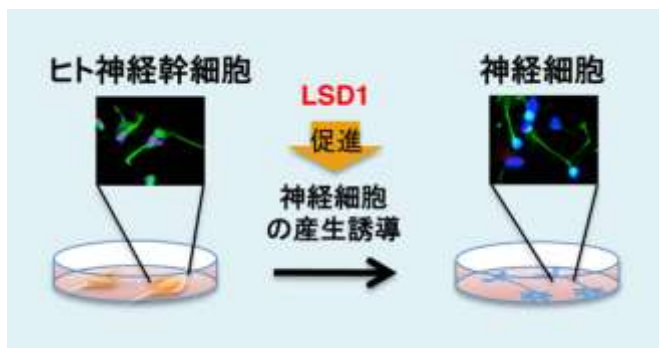
## 【ポイント】

- ヒト胎児脳の神経細胞の発生にLSD1と呼ばれる酵素が重要な役割を果たすことを発見
- LSD1の神経発達における役割がヒトに特徴的である可能性を示唆
- 失われた脳機能を回復させるための効率的な神経細胞の供給への貢献に期待

## 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016/pr20160328/pr20160328.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016/pr20160328/pr20160328.html)

(バイオメディカル研究部門)



&lt;次ページへ&gt;

&lt;前ページから&gt;

&lt;発表・掲載日：2016/03/29&gt;

## 葉表面の気孔の閉じ具合を調整しオゾン耐性を強化

ー大気汚染物質に強い作物の開発を目指してー

### 【ポイント】

- ・大気汚染物質であるオゾンに対する植物の耐性を強化できる転写因子を同定
- ・その転写因子は気孔の閉じ具合を調節する仕組みに関与していることを解明
- ・大気汚染物質などの環境ストレスに強い作物の開発への貢献に期待

### 【詳細はこちら】

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/press\\_release/pr2016/pr20160329/pr20160329.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2016/pr20160329/pr20160329.html)

(生物プロセス研究部門)



他機関の情報

## 四国CNFプラットフォーム設立記念セミナー

(主催：一般財団法人 四国産業・技術振興センター)

【日 時】 平成28年5月10日 (火) 13時30分～17時00分 (交流会：17時30分～19時00分)

【会 場】 かがわ国際会議場 (〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1高松シンボルタワー  
タワー棟6階) (交流会：第2小ホール (ホール棟5階))

【参加費】 無料 (交流会費：2,000円)

【定員】 200名

### 【プログラム概要】

#### 1. 開会挨拶

- ・主催者挨拶 一般財団法人 四国産業・技術振興センター 理事長 洲之内 徹 氏
- ・来賓挨拶 四国経済産業局長 成瀬 茂夫 氏

#### 2. 四国CNFプラットフォーム設立趣旨について

四国CNFプラットフォーム運営委員会 委員長 (愛媛大学教授) 内村 浩美 氏

&lt;次ページへ&gt;

&lt;前ページから&gt;

## 3. 講演

## (1) 基調講演

「セルロースナノファイバー ～産業資材は裏山から～」

京都大学生存圏研究所 教授 矢野 浩之 氏

## (2) 政策動向

「世界を動かすCNF素材 ～各国の動きと国の施策～」

経済産業省 製造産業局 紙業服飾品課 課長 渡邊 政嘉 氏

「セルロースナノファイバーの社会実装に向けた環境省の取組」

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 課長 松澤 裕 氏

## (3) 取組事例紹介

「CNFの増粘剤への応用」(CNF世界初『速書きでもカスれないボールペン!』)

第一工業製薬株式会社 事業本部 機能化学品事業部 課長 神野 和人 氏

「パルプから製造したCNFとその用途開発事例」

大王製紙株式会社 技術開発部 部長 玉城 道彦 氏

【問い合わせ先】〒760-0033 香川県高松市丸の内2-5  
 一般財団法人 四国産業・技術振興センター 産業振興部  
 E-mail: [cnf@tri-step.or.jp](mailto:cnf@tri-step.or.jp)  
 TEL : 087-851-7082 FAX : 087-851-7027

【参加お申込み、プログラム等の詳細はこちらから】

STEP

検索

CLICK!!

<http://www.tri-step.or.jp/>

他機関の情報

## 四国マイクロ波プロセス研究会第15回フォーラム 開催のご案内

(主催：四国マイクロ波プロセス研究会)

【日 時】 平成28年5月13日 (金) 13時15分～16時30分

【会 場】 e-とびあ・かがわBBスクエア (〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1高松シンボル  
タワー タワー棟4・5階)

【参加費】 無料

【参加お申込み、プログラム等の詳細はこちらから】

四国マイクロ波プロセス研究会

検索

CLICK!!

<http://www.d1.dion.ne.jp/~shunkato/>





他機関の情報

## 「平成28年度産学共同研究開発支援事業」の募集について ～企業と大学等の共同研究・製品開発に助成を行います～

(公募元：一般財団法人四国産業・技術振興センター)

STEP（一般財団法人四国産業・技術振興センター）は、イノベーション四国（※）と連携し、企業の技術開発・販路開拓をはじめとするイノベティブな取り組みに対する支援を行っております。このたび、四国の中小企業が大学・高専および公設研究所等と行う共同研究・製品開発について、下記の通り5月9日（月）から7月8日（金）の間、助成対象事業の募集を行います。

今年度の助成金額は1件あたり50万円程度、4件程度の採択を予定しています。

### ◆「産学共同研究開発支援事業」募集概要

1. 支援対象	四国内に本社または事業所を持つ中小企業
2. 対象事業	企業が取り組み中、または検討中の技術開発・製品開発のうち、大学・高専または公設試験研究機関等の研究者と共同で行う事業とします。
3. 支援対象経費 および助成金額	・当該事業の実施に直接必要な経費 ・1件あたり50万円程度を限度とします
4. 研究期間	1年（平成28年9月1日～平成29年8月31日まで）
5. 募集期間	平成28年5月9日（月）～7月8日（金） ※7/8（金）STEP必着
6. 応募方法	所定の申請書に必要事項を記載のうえ、STEPに提出 （申請書様式は、下記URLのSTEPホームページからダウンロード可） <a href="http://www.tri-step.or.jp/innovation/develop.html">http://www.tri-step.or.jp/innovation/develop.html</a>
7. 選考	審査委員会において、「技術面」、「事業化面」、「政策面」について、書類審査および必要に応じてヒアリングを行い評価した上で決定します。 採択件数は4件程度を予定しています。
8. 採否等の通知	8月上旬頃応募者宛に通知します
9. 実績報告	事業完了後、実績報告書を当センターに提出していただきます。
10. 応募に関する お問い合わせ・お申 込み先	〒760-0033 高松市丸の内2番5号 一般財団法人四国産業・技術振興センター 産業振興部 井上、田中 TEL：087-851-7081 FAX：087-851-7027 E-mail： <a href="mailto:step@tri-step.or.jp">step@tri-step.or.jp</a> URL： <a href="http://www.tri-step.or.jp/">http://www.tri-step.or.jp/</a>

※イノベーション四国（四国地域イノベーション創出協議会）

四国内の研究機関や産業支援機関など計32会員機関が平成20年度に設立した、企業が抱える課題の解決を四国の総合力で支援する組織。会員機関が、その保有する人材、ネットワーク、機器等の資源を活用し総合的な企業支援を行っている。運営に当たっては、STEPが事務局、産総研四国センターと中小企業基盤整備機構が副事務局を務め、四国経済産業局（以下「四経局」）が連携パートナーとして参画している。

【詳細はこちらから】

STEP 技術開発支援

検索

CLICK!!

<http://www.tri-step.or.jp/innovation/develop.html>